

**ANNEXE N°2 à l’acte d’engagement**

**CADRE DE REPONSE TECHNIQUE**

**N° de consultation :**

**MX25- 075**

**Fourniture et installation d’un système de photolithographie par écriture directe pour le laboratoire de Physique de la Matière Condensée (PMC) de l'Ecole polytechnique**

Le candidat a obligation de remplir le cadre de réponse technique.

Les items demandés dans ce cadre de réponse devront obligatoirement être renseignés dans ce document (même s’ils sont également abordés dans le mémoire technique). Ne seront pas pris en compte les renvois systématiques sur la totalité du cadre de réponse à des numéros de page sur un document annexe sous peine de rejet de l’offre.

A titre exceptionnel, il sera possible de compléter certains champs en renvoyant de manière précise vers le(s) titre(s) et le(s) page(s) d’une documentation annexe transmise avec la réponse ou du mémoire technique.

**Le candidat indique à quelle solution correspond la présente offre (à compléter) :**

**L’offre de base**

**L’offre de base + la variante n°1**

**CANDIDAT :**

|  |  |
| --- | --- |
| Nom de l’entreprise |  |
| Contact |  |
| Coordonnées (mail, téléphone) |  |

**Fourniture et installation d’un système de photolithographie par écriture directe pour le laboratoire de Physique de la Matière Condensée (PMC) de l'Ecole polytechnique**

* **Critère 1 : Valeur Technique (60 %)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Critères d’évaluation | | Réponse du candidat | **A titre exceptionnel en cas de complément**  N° de page du mémoire technique | |
| ***Sous-critère 1.1 –***  ***Noté*** **sur 15 %** | *Résolution minimale d’écriture* |  |  | |
| ***Sous-critère 1.2 -***  ***Noté sur 15%*** | *Vitesse d’écriture* |  |  | |
| ***Sous-critère 1.3 -***  ***Noté sur 5 %*** | *Automatisation du changement de résolution* |  | |  |
| ***Sous-critère 1.4 -***  ***Noté sur 5 %*** | *Reproductibilité et stabilité dans le temps des doses nécessaires à l’écriture* |  | |  |
| ***Sous-critère 1.5 -***  ***Noté sur 5 %*** | *Efficacité de l’autofocus*  *Caractéristiques de l’autofocus*  *(Utilisation, contraintes exigées par le système autofocus, temps nécessaire* *à l’autofocus par rapport au temps d’écriture etc…)* |  | |  |
| ***Sous-critère 1.6 -***  ***Noté sur 5 %*** | *Possibilité d’écrire sur des échantillons de différentes tailles (détailler la taille minimale et maximale d’échantillon compatible avec le porte échantillon de l’appareil, possibilité (ou non) de monter plusieurs échantillons à la fois, avec une écriture sur chacun qui ne nécessite pas de manipulation entre-temps des échantillons)* |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Sous-critère 1.7 -***  ***Noté sur 5 %*** | *Précision de l’alignement sur un échantillon ou motif existant, y compris sur la face arrière de l’échantillon*  *(Détailler la possibilité ou non d’alignement d’écriture avec un masque virtuel qui sera défini par l’utilisateur sur une image d’un échantillon monté dans l’appareil)* |  |  |
| ***Sous-critère 1.8 -***  ***Noté sur 5 %*** | *Qualité de l’offre logiciel :*  *- ergonomie,*  *- accès aux paramètres* |  |  |

* **Critère 3 : Conditions, modalités et durée de garantie des différentes parties du système de photolithographie (10 %)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Critères d’évaluation | Réponse du candidat | **A titre exceptionnel en cas de complément**  N° de page du mémoire technique |
|  |  |  |

* **Autres informations nécessaires pour juger de la conformité de l’offre ou pour l’exécution des prestations :**
* Autres caractéristiques techniques du matériel (à fournir en annexe),
* Délai de livraison à compter de la date de notification du marché : ***………….(à compléter)***
* Délai d’installation à compter de date définie dans l’ordre de service (article 6.2 du CCP) **: *………….(à compléter)***

L’installation du matériel devra être réalisée dans un délai maximum de 9 mois.